



Anexa nr.4

**ANUNȚ**

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, organizează selecția în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare, I.D. PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1340, având titlul **Process and device for thin films deposition in highly ionized pulsed plasma (PIDESS)**, pentru următoarele posturi:

**CS III (postdoctorand) - 2 posturi**

**1 post:**  $\frac{1}{4}$  normă, perioadă determinată, 01.09.2012- 31.05.2015

**1 post:**  $\frac{1}{4}$  normă, perioadă determinată, 01.09.2012- 30.03.2013;  $\frac{3}{4}$  normă, perioadă determinată, 01.04.2013- 31.05.2015

Data selecției: **31 august 2012**

Ora: **12 a.m.**

Locul desfășurării concursului: **Laboratorul de Fizica Plasmei,  
Facultatea de Fizica**

**1. Dosarele de concurs** se vor depune pînă la data de **30 august 2012**, ora **12,00**, la **Elena Radu, Departamentul de Cercetare si Managementul Proiectelor**, corp A, etajul 2, tel. **201024**, email: [eradu@uaic.ro](mailto:eradu@uaic.ro).

**2. Conținutul dosarului de candidatură:**

- cerere de participare la selecție;
- scrisoare de motivație;
- copie acte de stare civilă;
- curriculum vitae;
- diploma de licență (original și copie);
- diploma de master(original și copie);
- diploma de doctor(original și copie);
- copie după certificatul/atestatul de cunoaștere a unei limbi străine (TOFEL, DALF sau echivalent) exceptând cazurile în care candidatul a obținut diploma de licență și/sau master și/sau doctorat în străinătate (eventual cotelă).

**3. Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului de CS III (postdoctorand):**

- a) să fie absolvenți de studii superioare cu examen de licență sau de diplomă;
- b) să dețină titlul de doctor în domeniul postului;
- c) să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 4 ani;
- d) să aibă certificat/atestat de cunoaștere a unei limbi străine (TOFEL, DALF sau echivalent) exceptând cazurile în care candidatul a obținut diploma de licență și/sau master și/sau doctorat în străinătate (eventual cotelă).

**4. Probe de selecție:**

- Analiza dosarului candidatului (eliminatoire)
- Interviu

**5. Bibliografia:**

1. M.A. Lieberman, A. J. Lichtenberg: *Principles of plasma discharges and materials processing*, John Wiley, N.Y.(1994);
2. B.N. Chapman: *Glow discharge processes*, (New York: Wiley) (1980);
3. S.M. Rossnagel, J.J. Cuomo et W.D. Westwood: *Handbook of Plasma Processing Technology*. Noyes Publications, New Jersey, USA, 1990
4. Matthias Wolter, Hoang Tung Do, Hartmut Steffen and Rainer Hippler, *Aluminium atom density and temperature in a dc magnetron discharge determined by means of blue diode laser absorption spectroscopy*, J. Phys. D: Appl. Phys. 38 (2005) 2390–2395;
5. A. Goehlich, N. Niemöller, and H. F. Döbele, *Anisotropy effects in physical sputtering investigated by laserinduced fluorescence spectroscopy*, Phys. Rev. B 62, 9349–9358 (2000)

**6. Alte condiții de selecție și condiții de desfășurare a selecției:**

Ierarhizarea candidaților se va face în funcție de nota obținută la interviu și analiza contribuțiilor științifice relevante.

RECTOR  
Prof.univ.dr. Vasile Ișan



Întocmit, director proiect  
Prof.univ.dr. Gheorghe POPA